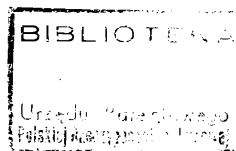


25 marca 1929 r.



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 9812.

Kl. 30 h 11.

Gustav Miran Eklund
(Stockholm, Szwecja).

Kąpiel odtłuszczająca.

Zgłoszono 15 grudnia 1927 r.

Udzielono 28 grudnia 1928 r.

Pierwszeństwo: 30 września 1927 r. (Szwecja).

Wynalazek niniejszy dotyczy kąpeli odtłuszczającej, która w porównaniu z innymi kąpielami posiada tę wyższość, iż rozpuszcza tłuszcz zawarty w skórze bez uczucia osłabienia, które wogóle w innych przypadkach przy użyciu kąpeli odtłuszczających występuje, pomimo że kąpiel zachowuje swą wysoką temperaturę.

W myśl wynalazku osiąga się to zapomocą dodania do wody kąpielowej ciała wytwarzającego pianę oraz ciała wyzwalającego po rozpuszczeniu w wodzie gaz wolny, stosując ewentualnie do przyspieszenia reakcji jeden lub więcej katalizatorów.

Jako ciało wytwarzające pianę można stosować mydło, mydło szare (miękkie), płatki mydlane i ciała podobne, i do wy-

twarzania gazu — dwuwęglan amonowy, który przy rozpuszczaniu w wodzie wydziela wolny dwutlenek węgla. Jako katalizatory można stosować bardzo wiele ciał, np. mąkę kartoflaną.

Kąpiel utworzona na tej drodze daje, skoro ją ubijać, pianę nieznikającą w ciągu godziny. Czas ten jest więcej niż dostateczny, aby przez pękanie pęcherzyków gazu wywołać masaż, zapomocą którego rozpuszcza się tłuszcz zawarty w skórze.

Wynalazek można stosować w najrozmaitszych postaciach wykonania, gdyż nie ogranicza się on do przytoczonego powyżej przykładu wykonania.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Kąpiel odtłuszczająca, znamienne

dodatkiem jednego lub więcej wytwarzających pianę ciał i jednego lub więcej ciał wydzielających przy rozpuszczaniu w wodzie gaz wolny.

2. Kąpiel odtłuszczająca, znamienna tem, że oprócz ciał wytwarzających pianę i wydzielających gaz dodaje się jeden lub więcej ciał kontaktowych lub katalizatorów.

3. Kąpiel odtłuszczająca według zastrz. 1 i 2, znamienna tem, iż do kąpieli dodaje się mydła, mydła szarego, płatków mydlanych i ciał podobnych, dwuwęglanu amonowego i mąki kartoflanej.

Gustav Miran Eklund.

Zastępca: K. Czempinśki,

rzecznik patentowy.